

イオンミリング装置

公益財団法人JKA

平成29年度 公設工業試験研究所等における機械等設備拡充補助事業

機種名 日本電子(株) SVM-721

仕様 加速電圧 2~8KV

ビーム電流 最大150 μ A

ビーム径 Φ 4mm

ミリングレート 最大 50nm/min(Si基盤)

試料サイズ 最大 Φ 50mm、t20.5mm

使用目的

走査電子顕微鏡観察試料【※】の表面を微細に削る(イオンミリング)加工を行う。

このことにより下記のようなことが期待できます。

○研磨により出来た塑性変形層の除去

○汚れ、酸化皮膜を除去して、オリジナルの表面を露出

○酸、アルカリなどでエッチングできないものの組織観察



この装置は、公益財団法人JKAの補助を受けて導入しました

※平成23年度に同補助事業で導入した「電界放射形走査電子顕微鏡システム」をより一層効果的に活用できます。